

産業構造審議会 知的財産分科会 意匠制度小委員会 報告書 「産業競争力の強化に資する意匠制度の見直しについて（案）」に対する意見

(1) 提案団体名：一般社団法人 日本国際知的財産保護協会

会長 長澤 健一

(2) 窓口担当者：国際協力部 石川 聖

(3) 連絡先：〒105-0001 東京都港区虎ノ門 1-14-1 郵政福祉琴平ビル 4 階

03-3591-5304

[satoshi.ishikawa@aippi.or.jp](mailto:satoshi.ishikawa@aippi.or.jp)

[masatoshi.abe@aippi.or.jp](mailto:masatoshi.abe@aippi.or.jp)

(4) 意見及び理由

1. 「画像デザインの保護」について

(1) 「保護対象の拡大」について

①A社意見：

意匠法の保護対象を拡大し、「物品に記録されていない画像」及び「物品以外に表示される画像」を保護対象とした場合、画像意匠が、従来の「物品」による限定から「機器等の機能」による限定に変更される結果、保護対象が広範になり、侵害の予見性が難しくなり、権利侵害リスクが高まるとの懸念がある。「機器等の機能」で権利範囲の限定が成されるとはいえ、その「機器等の機能」の考え方や限定の粒度、及び類否関係が不明確であれば、なおさら侵害の予見性は困難となると懸念される。このため、保護対象の拡大にあたっては、審査基準・ガイドライン等において、「機器等の機能」の考え方や限定の粒度について明記し、事例を充実させるなどして、類否関係を明確にさせていただくことを希望する。

②B社意見：

画像意匠について、物品との一体性要件を外すことにより、「物品に記録されていない画像」及び「物品以外に表示される画像」を意匠法の保護対象とし、保護対象を拡充するとの施策に賛同する。なぜなら、IoT、AI 等の技術革新により、人がモノを意識せずに情報へ直接アクセスすることが可能になり、これによって画像デザインはユーザーとのタッチポイントとしてより重要な役割を担っていくと考えられるからである。つまり、画像デザインは物品との関連性が薄れることで活用範囲が広がり、その価値がより高まっていくことになるため、物品との一体性要件はこのような新たな画像デザインの価値を適切に保護するための大きな制約となるからである。

但し、斯かる施策により、拡張現実や仮想現実などに用いられる虚像として表示される画像も保護対象に含まれることになると考えるが、これら虚像として表示される画像を図面や願書の記載でどのように特定するか、という観点での検討も必要であると考え。

#### (2) 「クリアランス負担軽減の施策」について

上記施策により、クリアランス負担も増大することが懸念されるが、物品ではなく「画像の機能」を明確にすることによって、クリアランス負担軽減を図ることには賛同する。

更に、例えば以下の対応もお願いしたい。

- ①画像の分類「W\*\*」の更なる細分化（これにより検索精度を上げることが可能となる）。
- ②画像の検索システムの構築。
- ③画像意匠の「機能」分類の新設。
- ④「画像意匠公報検索支援ツール」の機能拡充（分類やキーワードによる振分け機能の追加、類似画像検索精度の向上など）。
- ⑤「公知意匠」画像の検索が可能となるデータベースの提供。

#### (3) 「画像意匠の侵害行為の明確化」について

侵害訴追範囲の明確化のため、画像意匠の実施行為について、特許法のプログラム等の発明に係る実施行為同様の新たな規定を設けるとの施策には賛同する。「アプリを作成する行為」、「ネットワークを通じて提供する行為」及び「クラウドサーバーにアップロードする行為」を「侵害とみなす行為」とすることについては、現行法において曖昧であったからである。

但し、「端末でアプリを使用する行為」について、“一般ユーザーが「業として」使用していない場合”が対象とならない旨、条文に明記するとともに、ガイドライン等で明確化すべきであると考え。

### 2. 「空間デザインの保護」について

#### (1) 「保護対象の拡大」について

特にコメント無し。

#### (2) 「新規性・創作非容易性の明確化」について

特にコメント無し。

### 3. 「関連意匠制度の拡充」について

#### (1) 「関連意匠の出願可能期間の延長」について

①「本意匠の権利者による実施（製造・販売等）によって関連意匠の登録が妨げられないようにする」とのことであるが、具体的にどのような範囲までを「本意匠の権利者による実施」と判断されるのか明確にしていきたい。

例えば、

- A. 自社の実施（展示会）
- B. 自社の実施（展示会）に基づく他社の実施（展示会の記事）
- C. 自社の実施（展示会）を見て、他社が自分のものと見せかけて HP に公開、  
など、様々な公開態様が考えられる。

上記の例のうち、A は問題ないとしても、B や C まで「本意匠の権利者による実施」といえるのか、その判断基準を明確にしていきたい。さらに、出願人による立証要否、例えば新規性喪失の例外適用等は不要と考えているが、立証する必要がある場合等があれば明確にしていきたい。

②また、「本意匠の権利者による実施」と「新規性喪失の例外適用」規定との関係性を明確にしていきたい。

例えば、上記事例の場合、上述したように、A について新規性喪失の例外適用を受ける必要性はないと理解しているが、A で実施した意匠  $\alpha$  に類似する意匠  $\alpha'$  を自社で開発しその後公開した場合、後から意匠  $\alpha'$  を関連意匠として出願する際の新規性の判断はどのようになるのか、意匠  $\alpha'$  については新規性喪失の例外適用を受ける必要性があるのか、等を明確にしていきたい。

また、関連意匠の時期的要件を緩和いただいたのにもかかわらず、「新規性喪失例外の適用」を都度受ける必要性が生じてしまうのであれば、手続きが煩わしくなるため、手続きが簡便になるよう調整をお願いしたい。

## （2）「関連意匠にのみ類似する意匠の登録」について

関連意匠にのみ類似する関連意匠について、「関連意匠 A の公報発行後に”他人”が登録した意匠や”他人”が実施して公知となっている意匠等については、新規性や創作非容易性の判断において考慮されるべき」と記載されているが、第9回意匠制度小委員会の議事の中で「あくまで関連意匠制度というのは、自分との関係で新規性喪失の例外となるという整理で考えております。」（平成30年11月5日開催の第9回意匠制度小委員会議事録P18より引用）との説明があり、「”自己”の登録意匠や”自己”の公知意匠（Ex. 関連意匠 A の実施）」については、新規性や創作非容易性の判断において考慮されないと理解する。

この点については、審査基準やガイドラインの改定で止めるのではなく、法律の改正として関連する条文の見直しを行うべきと考える。

なお、関連意匠制度は、海外にない特殊な制度であり、今回の改正により複雑化するため、説明会等で周知を徹底していただきたいと考える。

## （3）その他

関連意匠制度の拡充によって「一貫したコンセプトに基づく製品群のデザイン保護」に関する一部の課題の解決がされることには首肯する。

しかし、製品開発の実態に照らすと、関連意匠制度の拡充のみでは解決しきれない課題も残るため、関連意匠制度という現行制度の拡充のみではなく新たな制度の導入についても継続した検討を要望する。なぜなら、長期間にわたって継続する製品デザインほど、技

術の進歩を製品に取り込む必要性などから、部分的には小さいとは言いきれないデザイン変更が生じることも起こりえる一方で、変更を重ねながらも後になるほどコンセプトの一貫性を表すデザイン要素部分が、より明確に特定されることもあるからである。これは関連意匠制度の修正のみでは解決しきれない課題であると考ええる。

つまり、本意匠となるべき最初に出願した全体意匠や、部分意匠で特定した要素では、コンセプトの一貫性を表すデザイン要素として過不足が生じてくるケースもあり、この場合には関連意匠制度の拡充だけでは、後継デザインを一群の意匠権で保護することは困難であると考ええる。

そのため、必ずしも関連意匠制度の拡充のみではなく、例えば、当初は全体意匠だったものを後から部分意匠として抜き出したり、当初の部分意匠で破線で開示していた範囲からこれを実線に含む別の部分意匠とするといったような形で、分割して出願することを可能とする制度を新たに検討いただくことも要望する（例えば、米国の継続出願制度や一部継続出願制度を参考とするような新たな制度など）。

#### 4. 「意匠権の存続期間の延長」について

##### ①A社意見：

意匠権の存続期間を「登録日から20年」から「出願日から25年」に見直すとの施策には、懸念がある。特許から意匠への変更に際して、特許の権利期間満了間際に意匠への変更にすると、実質的に5年間の権利期間の延長になるからである。現状では、権利満了まで維持される件数の比率は、平成28年に22%（「報告書」P10により引用）と、さほど高くないようではあるが、特許よりも権利期間が5年も長くなることには、その必要性も含めて疑問を感じる。

##### ②B社意見：

意匠権の存続期間を「登録日から20年」から「出願日から25年」に見直すとの施策には、賛同する。特許から意匠への変更出願や意図的な審査遅延によって、権利期間が延長されていることによる不公平を防止する点で、出願日起算は改正の意義が大きいからである。

##### ③C社意見：

意匠権の存続期間を延長する点には賛同する。長期に渡って使用され続けている一部の製品デザインに対しては、継続して発生する模倣品への対処の必要性などがあるからである。

但し、存続期間の起算日を登録日から出願日に変更することについては、反対する。起算日の変更については、現行の案件管理を変更するコストと手間をしのぐメリットがもたらされるとは考えられないからである。

#### 5. 「複数意匠一括出願の導入」について

①A社意見：

国際出願同様、国内の出願についても、複数意匠を一括出願できる制度を整備し、一の願書による複数の意匠についての意匠登録出願を認める、との施策には賛同する。斯かる施策により、外国からの複数意匠一括出願（国際出願含む）の形式的な拒絶通知が減ると期待されるからである。

②B社意見：

意匠毎に、①出願番号、登録番号等の付与、②公報発行、③関連付けの明示、等が行われ、クリアランス負担増にならないようにお願いしたい。

6. 「物品区分の扱いの見直し」について

物品自体が明確である場合には、物品区分表の区分と同程度の区分を記載していないことを拒絶理由の対象としないようにする、との施策には賛同する。

但し、現状行われている物品の職権訂正の機会も広げていただきたい。

以上